


# 國立彰化師範大學科技研究總中心所屬共同儀器中心

## 儀器使用人員教育訓練與資格檢定

課程名稱	自旋中心設施培訓研習會-光微影對準曝光系統	
課程目的	為了讓使用者對本校自旋中心所購置的光微影對準曝光系統有更進一步的認識，特舉辦本培訓研習會。	
課程說明	課程分為原理講解課程以及機台校正、維護與操作演示課程。 報名者需全程參。	
開放對象	<input checked="" type="checkbox"/> 限本校教職員及學生 <input type="checkbox"/> 限本校教職員 <input type="checkbox"/> 不拘	
儀器名稱 (中英文名稱)	光微影對準曝光系統 (Karl Suss MJB3)	
儀器照片 儀器簡介	<p>光微影對準曝光系統，乃是運用紫外光搭配光罩與光阻，將微米尺度以上的圖形轉移基板上的系統，也是現階段半導體產業的主要生產工具之一。本系統之光源為波長 236 nm 的深紫外，使用四吋光罩，樣品載台為二吋。曝光模式為接觸式，直接由人眼在顯微鏡下進行對準。對準過程可運用氣動示之微調移動顯微鏡之位置，檢視不同區域並進行對準。常用之光阻劑有 AZ 6112, LOR-5B, 與 SU8-2000s 系列，常用之最小線寬為三微米。</p>	
課程時間	2014 年 3 月 7 日	
課程地點	進德校區 <u>物理系格致館四樓會議室與三樓奈米元件暨低溫實驗室</u>	
報名方式	請以“報名光微影對準曝光系統教育訓練”為標題名稱，直接寄信至 <a href="mailto:yclee.ld@gmail.com">yclee.ld@gmail.com</a> 李彥琦先生 收。 信內請註明：姓名、系級、學號、指導教授、實驗室與 200 字內之研究簡介	
報名期限	2014 年 3 月 5 日 止	
招收人數	原理講解與操作演示與校正課程須全程參與， 不分梯次，上限 20 人	

收費	500 元，一率現場現金繳費。			
課程表	講題	日期	地點	主講人
	光微影對準曝光系統 原理與系統簡介	3 月 7 日 10:30~12:20	物理系格致館 四樓會議室	休斯微技術有限公司  資深工程師
	光微影對準曝光系統 操作演示	3 月 7 日 13:00~17:00	物理系格致館 三樓奈米元件 暨低溫實驗室	
課程表	項次	光微影對準曝光系統 原理與系統簡介訓練項目	光微影對準曝光系統 操作演示訓練項目	
	1	光微影對準曝光系統前言	系統硬體與開關機程序說明	
	2	光微影對準曝光系統硬體介紹	注意事項說明	
	3	光微影對準曝光系統運作原理	樣品放置與載臺構造介紹	
	4	結論	維護與示範	
	5	Q & A	演示結束	
	6		Q&A	
檢定項目 發證標準	本儀器採委託操作方式，故不進行檢定及發證			